

## ⑯ 公開特許公報 (A)

昭58-98917

⑯ Int. Cl.<sup>3</sup>  
H 01 L 21/205  
21/263

識別記号

庁内整理番号  
7739-5F  
6851-5F⑯ 公開 昭和58年(1983)6月13日  
発明の数 1  
審査請求 未請求

(全3頁)

## ⑯ 原子層エピタキシャル装置

⑯ 特 願 昭56-197858

⑯ 出 願 昭56(1981)12月9日

⑯ 発明者 岩松誠一

諏訪市大和3丁目3番5号株式

会社諏訪精工舎内

⑯ 出願人 株式会社諏訪精工舎

東京都中央区銀座4丁目3番4号

⑯ 代理人 弁理士 最上務

## 明細書

## 1. 発明の名称 原子層エピタキシャル装置

## 2. 特許請求の範囲

真空容器内には試料保持がなされ、かつ、該真空容器内にエピタキシャル成長させるための原子を含むガス化合物の導入部が設けられ、かつ、少なもとも試料表面を光照射するランプが設けられた事を特徴とする原子層エピタキシャル装置。

## 3. 発明の詳細な説明

本発明は、原子層エピタキシャル装置に関する。

最近、T. Santo(a, J. Antson, A. Pakka(a and S. Lindfors, "Atomic Layer Epitaxy for Producing EL-Thin Films," 1980 S/D International Symposium, Digest of Technical Papers, P. P. 106-109, Apr. 1980.

に示される如く、真空容器内の試料表面にガス吸着を1層づつ行ない、該ガス吸着層を還元することにより1原子層のエピタキシャル層成長が可能となつた。

しかるに、前記従来技術では、試料基板の加熱を要する事および2種のガス導入を要するなど、処理時間を要し、低温成長が不可能等の欠点があつた。

本発明は、かかる従来技術の欠点をなくし、高速でかつ低温の原子層エピタキシャル成長が可能な装置を提供することを目的とする。

上記目的を達成するための本発明の基本的な構成は、真空容器内には試料保持がなされ、かつ、該真空容器内にエピタキシャル成長させるための原子を含むガス化合物の導入部が設けられ、かつ少なくとも試料表面を光照射するランプが設けられた事を特徴とする。

以下、実施例を用いて本発明を詳細に説明する。  
第1図は、本発明による原子層エピタキシャル装置の一実施例を示す。1は真空容器支持基板、

2はベルジャー、3は真空ポンプ、4は試料台、5はB1ウエーハ等の試料、6はガス導入口であり、7はバルブ、8は流量計である。

9および10はゴム等からなる真空保持のためのパッキンであり、11は光シヤツター、12は石英窓、13はシヤツター駆動モーター、14は水銀ランプ、15はランプ・ハウスである。真空容器内は真空ポンプ3により  $10^{-6}$  Torr 以上の真空層に保たれ、試料表面は予め通常のArガス放電による清浄化が計られるものとする。ガス導入口6から微量のB1Cl<sub>2</sub>等のガスを導入することにより、試料表面には一分子層のB1Cl<sub>2</sub>が形成され、その後、シヤツター11を開き、13ランプ14からの光を試料表面に照射することにより、試料表面に吸着せる1分子層のB1Cl<sub>2</sub>が分解し、B1とCl<sub>2</sub>とに光分解され、B1が試料表面に1原子層で形成されることとなる。

この反応を、従来の方式による反応との対比で今少し詳細にのべると、従来技術では、第2図に示すごとく、B1ウエーハ基板上にB1原子を1

3…真空ポンプ	4…試料台
5…試料	6…ガス導入口
7…バルブ	8…流量計
9, 10…パッキン	
11…シヤツター	12…石英窓
13…モーター	14…水銀ランプ
15…ランプ・ハウス。	

以上

出願人 株式会社 謙防精工會

代理人 弁理士 城上

特開昭58-98917(2)

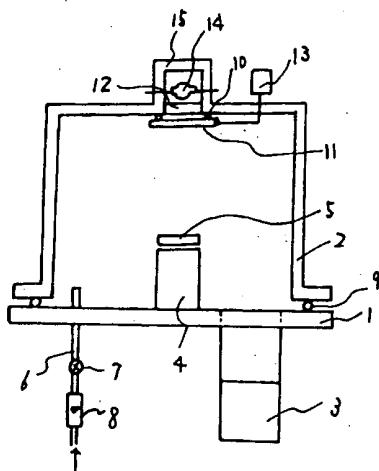
層エピタキシャル成長させる場合、(a)B1基板上へのB1Cl<sub>2</sub>吸着、(b)B1Cl<sub>2</sub>吸着層上へのB1層吸着、反応、(c)HCl除去の3工程が基板温度を常温～300もの範囲で制御しながら行なわれるのに對し、本発明では、第3図に示すごとく、(a)B1基板上へのB1Cl<sub>2</sub>吸着、(b)光照射によるB1Cl<sub>2</sub>分解によるCl<sub>2</sub>ガス除去の2工程が常温から100°C以下で行なわれる。

上記の如く、本発明による原子層エピタキシャル装置では、反応工程が短縮され、高速で原子層エピタキシャル処理ができると共に、常温で原子層エピタキシャルが可能となる効果がある。

#### 4 図面の簡単な説明

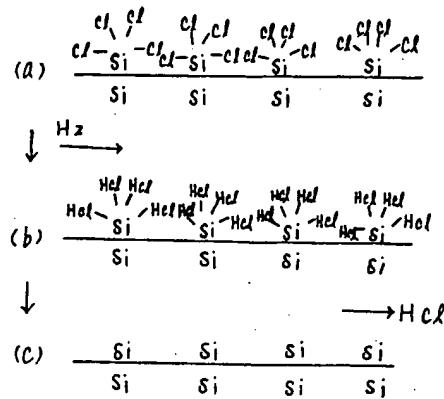
第1図は、本発明の一実施例を示す原子層エピタキシャル装置の概略図である。第2図は、従来の原子層エピタキシャル反応、第3図は、本発明による原子層エピタキシャル反応を模式的に示したものである。

1…真空容器基板 2…ベンジャード



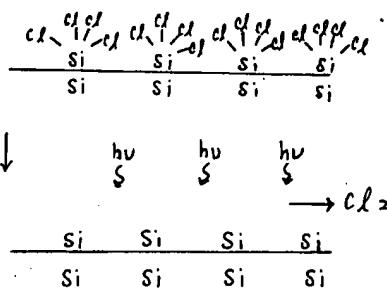
第1図

Sichy →



第2図

Sichy →



第3図

THIS PAGE BLANK (USPTO)